特開昭58-224448 (2)

本発明の別の目的は反射層に低融点金属または ブロンズ光沢をもつ色紫を使用することにより、 さらに高い記録感度を得ることである。

本発明に用いられる低触点金属としては、B1、 Te、Be、Bn、Ge、In、As、Pb、Znなどの比較的 低融点を示す金属あるいはそれらの合金をあげ

– 5 –

ジャニソール置換ペリレン、 O.I.ソルペントブルー、マゼンタペース、 鉛フタロシアニン、O.I. ダイレクトブルー 1 0 8 (O.I. 5 1 3 2 0)、 6 ー ア オノー 3 ー ヒドロキシー 9 ー (2 ー カルボキシフェニル) ー キサンチリウムクロリド、O.I. ヴァットブルー 1 (O.I. 7 3 0 0) かよびメチレンブルーなどがあるとともできる。 また、本発明にかけるブロンズ光沢をもつ色素は例えば蒸溜または預別塗布法により基板生に 1 0 ~ 1000nmの厚さで適用される。

本発明における吸収層として用いられる化合物は下記の構造式①および⑪で表わされるアントラキノン骨格またはインダンスレン骨格上に 程々の世換茶を有するものである。

(a) 構造式(1)

ることができる。前配金銭またはそれらの合金 は例えば蒸溜法やスパッタ法によつて基板上に 10~1000nm の厚さで適用することができる。 また、プロンズ光沢をもつ色素としては、シア ニン系またはメロシアニン系色架。トリフエニ ルメタン系染料、キサンテン系染料、ナフトキ ノン系色素、スクウオレニウム系色素、フタロ シナニン系染料、ペリレン顔料、およびジオキ サジン化合物などを適宜選択使用できる。その 例には、2-(1-(3-エチル・2-ペンゾ チャゾリニリデン) - 1.3.5 - ヘブタトリエニ ル] - 3 - エチルベンソチアゾリウムクロリド、 2.4 - ピス - (2.4.6 - トリヒドロキシフェニ ル) - 1,3 - シクロブタジエネデイリウム-1,3 - ジチオレート、 1.3 - ビスー〔3-エテルー ペッズチ丁ゾリニリイデン - (2) - メチル〕 - フ エナレニウムテトラフルオロボレート、 N.H'-

- 4 -

(式中、 X1、 X2、 X3かよび X4はそれぞれ水景、 アルキル基、ヒドロキシル基、ニトロ基、 T ミ ノ基、シアノ基かよびハロゲンを 表わし、 Y は 水素かよび スルホネート 基を 表わし、 Ar1 は水 常、フェニル基、ナフチル基かよび それらのス ルホン 化物かよび塩を 表わしそして 的 配 フェニ ル基は アルキル 基、 アルコキシ基、 T ミノ 基、 アルキルカルボニル基、メチルチオ 基、 ハロゲ ンかよび フェニルカルボニル 番によつ て 置換さ れていてもよくそして Ar2 は水素、フェニル基、

特開昭58-224448 (3)

およびそれらのスルホン化物および塩を扱わし そして削配フェニル基はアルキル基、アルコキ 少基、アミノ基、アルキルカルポニル基、フェ ニルカルポニル基およびハロゲンによつて置換 されていてもよい)。

(b) 構造式(D)

(式中、X1、X2、X5 およびX4 は上記と同じ意味を有し、X5 は水素 -NH-Ar1 および -B-Ar を表わし、 Z は水業、 -NH-Ar1 および -B-Ar1を表わし そして Ar1 は上記と同じ意味を有する)。

特に、構造式ODのようにインダンスレン骨格をもつ化合物は極大吸収波長がBODnm付近であるため、半導体レーザー用の材料としては最

酸ナトリウム・4・アニリノ・1・アントラキ ノリルアミノ)ペンゼン、 1.4 - ピス (4 - (4 - スルホン酸ナトリウム-フエニルアミノ)= 1-アントラキノリルアミノ)ペンゼン、 1.4 - ピスアニリノアントラキノン、 1,4 - ピス(4 - メチルフエニルアミノ)アントラキノン、1,4 - ピス(4-メトキャフエニルアミノ)アント ラキノン、 1.4 - ピス(4 - アミノフエニルア ぇノ)アントラキノン、 1.4 ヮピス(4ヮペン ソイルフエニルアミノ)アントラキノン、1.4 - ピス(4-クロロフエニルアミノ)アントラ キノン、 1,4 - ピス(4・アセチルフエニルア ミノ)アントラヤノン、 1,4 - ピス(ナフチル T ŧ 丿) アットラキノン。 1.4 - ピス (4 - ス ルホン酸ナトリウムフエニルアミノ)アントラ 中ノン、 1,4 -ビス(3 - スルホン酸ナトリウ ム - 4 - メチルフエニルTミノ) アントラキノ 適である。

上記構造式(I) かよび Mで 扱わされる アントラキノン 誘導体の 例を以下に示す。

1 - T ミノー 4 - (4 - スルホン酸フェニルアミノ) - 6.7 - ジニトロTントラキノンとサトリウム塩、1 - T ニリノー 2 - スルホン酸ナトリウム塩・4 - (4 - メチルフエニルアミノ)アントラキノン、8.17 - ビスー(4 - メトシアエニルアミノ) - 1.4 - ビスアンスレン、1.4 - ビスアン、1.4 - ビンフェニルアミノ) - 6.7 - ジシアノアトリウムー 4 - クロフェニルアミノン、1 - (2 - メチルフェールアミノン、1 - (2 - メチルフェールアミノ) - 2 - スルホン酸ナトリウムー 4 - ロアントラキノン、1 - (2 - メチルアニルアミノ) - 6.7 - ジニトロアントラキノン、1.4 - ビス(3 - スルホン

— B —

ン、 1.4 - ピス (3 - スルホン酸 - 4 - メトキ シフエニルアミノ)アントラキノン、 1.4 - ピ スアニリノ・ 6.7 - ジニトロアントラキノン、 1-Tニリノ-4-(4-メチルフエニルアミ ノ) - 6.7 - ジニトロアントラキノン、 1.4 -ピス(4-スルホン酸ナトリウムフエニルアミ ノ)- 6.7 - ジシアノアントラキノン、 1 - ア ニリノ・4-(4-ニトロフエニルアミノ)ア ントラキノン、1‐(4‐メトキシフエニルで ミノ) - 4 - (4 - ニトロフエニルアミノ) ア ントラキノン、テレフタルTミド、 N.N' - ビス - {2-プロモー4~(2-メチルチオ アニリ ノ) - 1 - アントラキノリル)、1 - (4 - ス ルホン酸ナトリウムフエニルアミノ) - 4 - (4 - メチル - 3 - スルホン酸ナトリウムフエユル アミノ) - 5.8 - シアノアントラキノン、 1.4 - ピス(4-メチルフエニルアミノ) - 6.7 ·

特開昭58-224448 (4)

ジクロロアントラキノン、 1.4 - ピス(4 - エ トキシフエニルアミノ) - 6.7 -ジェトロアン トラキノン、 8.17 -ピス(4-メチルフエニル ナミノ)インダンスレン、 8,17 -ピス(4 - ク ロロフエニルTミノ)インダンスレン、2,3,11,12 - テトラニトロ・8、17 - ピスアニリノインダン スレン、 6.15 -ピス(2-メチルチオフェニル アミノ) インダンスレン、 6,15 -ピスー(3.5 - ジェトキシフエニルアミノ) インダンスレン、 8.17 ~ピス(アニリノ) インダンスレン、8.17 - ピス(4- スルホン酸ナトリウムフェニルア ミノ)インダンスレン、 8.17 -ビスフェニルチ オインダンスレン、 8,17-ピス(2-メトキシ フェニルアミノ)インダンスレン、 8,17 -ビス (3 - メトキシフエニルアゼノ) インダンスレ ン、 8,17 -ピス(2-メチルフエニルアギノ) インダンスレン、 8.17~ピス(3 ~メチルフェ

-11-

ニル丁ミノ)インダンスレン、 8,17 -ビス(2 - クロロフエニルアミノ)インダンスレン、8.17 - ビス(3 - クロロフエニルアミノ)インダン スレン、 8,17 -ピス(2-メチルチオフェニル Tミノ)インダンスレン、 8,17 -ピス(3 - メ チルチオフエニルアミノ)インダンスレン、8.17 - ビス(4-メチルチオフエニルアミノ)イン ダンスレン、 8,17 -ピス(4-フエニルチオフ エニルアミノ)インダンスレン、 8.17 -ピス (2,5 - ジメトキシフエニルアミノ) インダン スレン、 8,17 -ピス(4 - メチル - 2 - クロロ フェニルTミノ) インダンスレン、 8,17 -ピス (2,4,6-トリメテルフエニルアミノ) インダ ンスレン、8.17 -ピス(1-ナフチルアミノ) インダンスレン、 8.17 -ビス(2-ナフチルア ミノ) インダンスレン、 B,17 -ピス(2 - メト キシフェニルチオ) インダンスレン、 8.17 -ビ

— 1 2 —

ス(4-フエニルフエニルTミノ)インダンス レン、 B. 17 -ピス(2 - メトキシー4 - スルホ ン散ナトリウムフエニルアミノ)インダンスレ ン、 8,17-ピス(3 - メトキシー 4 - スルホン 酸ナトリウムフェニルアミノ)インダンスレン、 8.17-ピス(4-メトキシ-2-スルホン酸ナ トリウムフエニルアミノ)インダンスレン、8,17 - ピス(2-メチル-4-スルホン酸ナトリウ ムフェニルアミノ)インダンスレン、 8.17 -ビ ス(3-メチル-4-スルホン酸ナトリウムフ エニル丁ミノ)インダンスレン、 8,17 -ビス(4 - メチル - 2 - スルホン酸ナトリウムフエニル アミノ)インダンスレン、 8,17 -ピス(2 - メ チルチオ・4・スルホン酸ナトリウムフエニル ナミノ)インダンスレン、 8.17 -ピス(3-メ チルチオー4-スルホン酸ナトリウムフエニル T も ノ) インダンスレン、 8,17 -ピス(4 - メチ

ルチオ・2 - スルホン酸ナトリウムフエニルア ミノ) インダンスレン、 B,17 -ピス〔 4 - (4 - スルホン酸ナトリウムフエニルチオ) フエニ ル丁ミノ]インダンスレン、 B.17 -ピス(2.5 - ジメトキシ - 4 - スルホン酸ナトリウムフエ ニルアミノ) インダンスレン、 8.17 -ピス〔1 - (4 - スルホン散ナトリウムナフテル) アミ ノ) インダンスレン、 8.17 -ピス〔2 - 〔4 -スルホン酸ナトリウムナフチル)アミノ〕イン ダンスレン、 8.17 -ピス(4 - ヒドロキシフェ ニルアミノ)インダンスレン、8,17-ピス(3 - ヒドロキシフエニルTミノ)インダンスレン、 8.17 -ビス(2 - ヒドロキシフエニルアミノ). インダンスレン、 6,15 -ピス(2 - クロロフエ ニルナミノ)インダンスレン、 6,15 -ピス(3 - クロロフエニルアミノ)インダンスレン、6.15 - ピス(4・クロロフエニルTミノ)インダン

特開昭58-224448(5)

スレン、 6.15 -ピス(2 - メチルフエニルアミ ノ) インダンスレン、 6.15 -ピス(3-メチル フェニルアミノ)インダンスレン、 6,15 -ピス (4 - メチルフエニルアミノ) インダンスレン、 6,15-ピス(4-クロロ-2-メチルフエニル アミノ)インダンスレン、 6,15 -ピス〔 3 ~(メ チルチオ)フエニルTも丿〕インダンスレン、 6,15-ピス〔2-(メチルチオ)フエニルアミ ノ] インダンスレン、 6,15 -ビス(2-メトキ シフエニルTミノ)インダンスレン、 6.15・ピ ス(3-メトキシフェニルアもノ)インダンス レン、 6,15 -ピス(4-メトキシフエニルアミ ノ) インダンスレン、 6,15 -ビス (4 - エトキ シフェニルアミノ)インダンスレン、 6.15 -ビ ス(1-ナフチルアミノ)インダンスレム 6.15 - ピス(2 - ナフチルTミノ)インダンスレン。 6.15 -ピス〔4‐(フエニルチオ)フエニルア

-15-

トリウム - フェニルT ミノ)インダンスレン、
6,15 - ピス(4 - T ミノフェニルチオ)インダ
ンスレン、 6,15 - ピス(4 - メチルフェニルチ
オ)インダンスレン、 6,15 - ピス(4 - スルホ
ン酸ナトリウム - フェニルチオ)インダンスレ
ン。

本発明における吸収層は上述したよりになる トラキノン構造またはインダンスレーの成分(他の 力る化合物単独またはそれらと他の成分(他の 色景を含めて)との組合せに経際はなる。 吸収層は、上記化合物を程度に溶解させ、 る方式、他の色素との投資を混合して、 を激化である方式、他の共変をして、 を激化である方式、他の大式、のの 色素との混合を変布する方式、他の を素との混合を変布する方式、他の ともには間になる。その際、としてに アVA、PVP、ポリピニルブチラール、ポリカーボ

ミノ) インダンスレン、 6,15 ~ビス(2-クロ ロ-4-スルホン散ナトリウムフエニルアミノ) インダンスレン、 6,15 -ピス(3 - クロロ - 4 - スルホン酸ナトリウムフエニルアミノ)イン ダンスレン、 6,15 -ピス(4 - クロロー 2 - ス ルホン酸ナトリウムフエニルTミノ)インダン スレン、 6.15 -ピス(2 - メテル - 4 - スルホ ン酸ナトリウム - フェニル Tミノ)インダンス レン、 6,15 -ビス(3 - メチル - 4 - スルホン 酸ナトリウム - フェニルアミノ) インダンスレ ン、 6.15-ピス(4 - メチル - 3 - スルホン散 ナトリウム - フェニル Tミノ) インダンスレン、 6.15-ピス(2-メトキシ-4-スルホン酸ナ トリウム - フエニル アミノ) インダンスレン、 6,15-ピス(3-*トキシー4-スルホン散ナ トリウム・フェニルアミノ)インダンスレン、 6,15-ピス(4-メトキシー2-スルホン酸ナ

-15-

次に、図面を参照して本発明の光学的情報記録 録媒体の構成例を以下に示す。

第1図は本発明の記録媒体の基本構成を示す 概念図であつて、基板1上に反射描2を設け、 さらにその上に吸収描3を設けたものである。 基板としては、ガラスおよびブラスチック例え はアクリル、ポリカーポネートなど透明なもの

特開昭58-224448 (6)

が用いられる。また、下引を層 4 や、保護層 5 の両方もしくはそのいずれかを設けても何らさしつかえはない。第 2 図にはその両方を設けた例を示した。情報の記録は、基板を通して行なわれる。

1,

-19-

この配録媒体に、照射面エネルギー 8 m W かよびピーム径 1.6 µm の半導体レーザー光を照射して 1 MHs の信号を記録した。

ピットあたりの配録閾値は Q 6 nJ/ピットで ありそしてピット径は 1.3 µm であつた。

夹施例 2

ガラス板に、ポリピニルブチラールを 1.5 Am の P さに 強布して下引き層とした。 この 基板に、 Be および Bn を 2: 1 の 割合に なるように 共 蒸 着して P さ 1 0 0 nm の 反射層 を 得 た。 さらに、 この 上に、

ポリピニル丁ルコール

0.59

水

109

B,17ゼス(2-メトキシャ4-スルホン酸 フエニルアミノ)インダンスレン D. 3 👂

の組成よりなる溶液を回転塗布して光吸収層を 得た。 情報の記録はレーザーなどの高エネルギービームのスポットを反射層の個から照射することによりなされ、吸収された無により記録層に穴があき記録がなされる。もちろん、吸収層の個からの記録も可能である。また、情報の読出しは低出力レーザービームを照射し、反射光量の変化により検出することができる。

以下に実施例によつて本発明をさらに詳しく 説明するがこれに限定するものではない。 実施例 1

アクリル板に、Te を厚さ 1 0 0 nmに蒸溜して 反射層を得た。さらに、この上に 8,17 - ピス(4 - フェニルフェニル アミノ) インダンスレンを 厚さ 1 5 0 nmに蒸溜し光吸収層とした。

とうして得られた記録媒体の800nmにおける反射率かよび透過率はそれぞれ43%かよび 2%であつた。

-20-

とうして得られた記録媒体の B 0 0 nmにおける反射率および透過率はそれぞれ 3 7 % および 1 % であつた。

この配録媒体に実施例1と同様にして情報を 記録したところ、記録閾値0.7 nJ/ピットで直径1.4 μm のピットが形成された。

実施例 3

 アクリル板に、厚さ 7 0 nm の A 8 1 α 8 e 3 α T e 4 α 蒸 箱腹を設け、反射層とした。さらに、この上に

1,4 - ピス - (4 - メトキシフエニル Tミノ) - 6,7 - ジシ丁ノ丁ントラキ 18

ジクロルエタン

107

の組成よりなる溶液を回転適布して光吸収層を得た。

こうして得られた記録媒体の B 0 0 nmにかける反射率かよび透過率は、それぞれ 3 3 % かよび 1 2 % であつた。

特開昭58~224448 (B)

奥施例	反射層	形成方法	光 骏 収 層	形成万法	反射率(800 mmにおける)	遊遊率(800 皿における)	即科斯佩
6	1,3 - ビス - (3 - エチル - ベンズ - チアゾリニリデン -(2) - メチル) - フ エナレニウムテトラフルオロボレート	童布 (溶媒:水)	6.15-ビス - (3.5 -ジメトキシフエニル - Tミノ) インダンスレン	蒸加	2 2 %	4 %	0.5 nJ/pit
7	N,N4ジアニソール世換ペリレン	法知	8.17-ビス〔4‐〔4‐スルホン酸ナトリ ウム‐フエニルチオ]フエニルアミノ] イ ンダンスレン	強布 (密媒:水)	2 6	4	0. 5
8	C.I.ソルベントブルー	塗布 (無線:水)	8,17-ビス - (4 - メトキシフエニル丁ミ ノ) インダンスレン		2 0	2	0.4
9	マゼンタベース	盗布 (飛似:ジク ロルメタン)	8.17- ビスアニリノイ <i>ンダンス</i> レン	热编	28	.	0.6
1 0	鉛フタロシアニン	蒸殆	1-(2 - メチルフエニルブミノ) - 2 - ス ルホン敏ナトリウム - 4 - (4 - ブミノフ エニルアミノ) - 6,7 -ジニトロ - ブント ラキノン	(裕保:水)	18	7	0.8
1 1	a.I.ダイレクトブルー108 (a.I.51320)	強布 (密媒:水)	8.17-ビス(2-メチルチオフエニル丁ミ ノ) - インダンスレン	蒸淘	2 4	3	0.6
1 2	6 - Tミノ - 3 - ヒドロキシ - 9 - (2 - カルボキシフエニル) - キサン チリウムクロリド	<u> </u>		· 盗布 (治媒:水)	2 5	1 6	1.1
1 3	0.1.ヴァットブルー1 (0.1.73000)	底然	8,17ピス(1-ナフチルブミノ) -イン ダンスレン	●機器 ∨	2 5	2	0.6
1 4	メチレンブルー	施布 (裕線:水)	8.17-ビスアニリノインダンスレン)	蒸煮	2 8	3	0.7

- 2 e -

與施例 15

とりして得られた記録媒体の 8 0 0 nmにおける反射率および透過率はそれぞれ 3 8 % および 3 % であつた。

この記録媒体に、実施例 1 と同様にして信号を記録したところ記録閾値 0. 4 nJ/ビットで直径 1.4 μm のピットが形成された。

奥施例 1 6

ガラス基板に、光重合性のメタクリル酸メチルモノマーを塗布し紫外線照射によつて硬化させ下引き層を得た。

との器板に、 6.15 -ピス(4 - アミノフエニルチオ)インダンスレンを厚さ 1 0 0 nmに蒸着

して光吸収層を得た。さらに、この上にTeを厚さ50nmに蒸駕して光反射圏とした。

とのようにして得られた記録媒体の B O O nm における反射率および透過率は、それぞれ 4 2 % および 4 % であつた。

この配母媒体に実施例1と同様にして情報を 配録したところ、記録閾値0.4 nJ/ピットで直径1.4 μm のピットが形成された。

奥施例 17

実施例 1 6 で 符 られた 記録 解体上 に、 810 を 厚さ 5 0 0 nm に 蒸着して保護 耐とした。

. 実施例 1 と同様にして信号を記録したところ、 記録閾値 0. 7 nJ/ピットで直径 1.2 Am のピット が形成された。

本発明で使用するその他の低融点金貨または ブロンズ光沢をもつ色素あるいはアントラキノ ン誘導体について、上配実施例に配収した方法

と同様にして光配母用態体を作成し情報を記録 したところ同様の特性が得られた。

上述のようにして構成された本発明の光記録 用媒体は半導体レーザーの波長域に吸収を有し、 安定性が高くしかも長期間の情報保存にすぐれ た効果を奏するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第5図は本発明の光学的情報配 録媒体の構成を示す概念図である。

1 … 基板、 2 … 反射層、 3 … 吸収層、 4 … 下引き層、 5 … 保護層、 6 … スペーサー。

特許出願人 株式会社 リ コ -

代 堆 人 弁理士 山 下



特開昭58-224448 (日)

_ 2 9 _